Министерство образования и науки Российской Федерации

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. **ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра физики твердого тела

## СОЗДАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТР НА ОСНОВЕ ВОЛНОВОДНО-ЩЕЛЕВЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВОРСКОЙ РАБОТЫ

студента 4 курса

направления 11.03.04 "Электроника и наноэлетроника"

факультета нано- и биомедицинских технологий

Головешко Олега Владимировича

## Научный руководитель

профессор, д.ф.-м.н.

должность, уч. степень, уч. звание

Зав. кафедрой

профессор, д.ф.-.м.н.

должность, уч. степень, уч. звание

Д.А.Усанов

подпись, дата

инициалы, фамилия

Саратов 2017

А.В.Скрипаль инициалы, фамилия

подпись, дата

Введение. Быстрое развитие в сфере нанотехнологий привело к получению нового класса периодических структур, под названием фотонные кристаллы. Их структуры состоят из периодически расположенных компонентов, соизмеримы с длиной волны электромагнитного излучения способного распространяться внутри них. В спектре пропускания такой структуры имеется частотная область, запрещенная для распространения электромагнитной волны которая является аналогом запрещенной зоны в кристаллах. С появлением нарушений периодичности в слоях структуры в запрещенной зоне такого фотонного кристалла могут возникать так называемые "окна прозрачности".

Таким образом в СВЧ- диапазоне одномерный фотонный кристалл может быть создан с помощью планарных линий передач с периодически изменяющейся структурой На основе таких СВЧ - фотонных кристаллов создаются полосовые фильтры, перестраиваемые резонаторы, антенны миниатюрных размеров . У СВЧ - фотонных кристаллов имеется высокая чувствительность к частотной зависимости" окно прозрачности" в запрещенной зоне к нарушению периодичности в слоистой структуре

Такого рода структуры используются в акустоэлектронике при создании линий задержки, в микро- и наноэлектронике и других областях.

Цель данной работы: Исследование свойств периодических структур на примере фотонного кристалла. Провести анализ амплитудно-частотных характеристик фотонного кристалла, в виде волноводно-щелевой линии передачи, при изменении особенностей конструкции, параметров диэлектрической подложки, а также провести исследование СВЧ фотонного кристалла С нарушением В виде изменённого расстояния между центральными отрезками щелевых линий, образующих фотонный кристалл.

## Основное содержание работы

Фотонные кристаллы в СВЧ- диапазоне. Все больше растет интерес к фотонным кристаллам СВЧ- диапазона. Основным преимуществом является что их модель можно собрать из макроскопических материалов. Такой одномерный фотонный кристалл в СВЧ- диапазоне может быть создан при помощи волноводов заполненных диэлектриком, так и планарных линий передачи с периодически изменяющейся структурой (рис.2.1). В реальных кристаллах в периодичности структуры могут возникать нарушения в запрещенной зоне такого кристалла возникают "окна следовательно прозрачности"(2.2). Это позволяет использовать микрополосовые фотонные кристаллы для определения параметров материалов СВЧ- диапазона. К примеру исследовать взаимодействия электромагнитного излучения в сверхвысокочастотном диапазоне с одномерными волноводными фотонными кристаллами, содержащие неоднородности в виде металлических плёнок наноразмеров, диэлектрических слоев и полупроводниковых материалов. Или, например, для определения электрофизических параметров как неполярных, так И полярных жидкостей, обладающих значительной действительной величиной мнимой частей диэлектрической И проницаемости в СВЧ-диапазоне.



a)



Рисунок 2.1 - Примеры фотонных кристаллов СВЧ –диапазона: а) микрополосковая линия; б) одномерный волноводный фотонный кристалл.



Рисунок 2.2 - Примеры спектров пропускания фотонного кристалла: a) без наличия нарушений в структуре; б) с наличием нарушений

На данный момент времени появилась новая область науки по изучению свойств искусственно созданных ФК, а также устройств, работающих на их основе. Такие устройства, выполнены на основе идеи периодичности неоднородностей представляют собой В структуре И систему электромагнитно связанных резонаторов, превосходящие пределы оптического диапазона. С точки зрения практического использования к ним обусловлен интерес наличием окон прозрачности и полос заграждений а именно фотонных запрещенных зон (ФЗЗ).

Одномерные микрополосковые фотонные кристаллы (МФК) являются наиболее удачными аналогами диэлектрических одномерных фотонных кристаллов (ОФК) в оптическом диапазоне. Диэлектрические одномерные фотонные кристаллы представляют собой тонкопленочные покрытия из чередующихся немагнитных слоев, различающихся показателем преломления.

Величина связи смежных слоев-резонаторов друг с другом, а наружных еще и со свободным пространством определяется различием диэлектрических проницаемостей. Очевидно, что такие одномерные структуры могут представлять собой устройства частотной селекции фильтры и отражатели.

МФК в общем случае, выглядят как собой последовательно соединенные чередующиеся отрезки линий с "большой" шириной полоскового проводника, имитирующие слои с высокими показателями преломления, и с "малой" шириной проводника, имитирующие слои с низкими показателями преломления. По мимо этого, в микрополосовых линиях передачи основными распространяющимися модами колебаний являются квази-Тволны, структура высокочастотных полей которых близка к поперечным волнам, распространяющимися в оптических ОФК.

Теоретическое исследование СВЧ фотонных кристаллов на основе волноводно-щелевых линий передачи. Модель СВЧ фотонных кристаллов на основе волноводно-щелевых линий передачи

Исследования были проведены при помощи системы электродинамического моделирования и проектирования HFSS. На (рис 2.1) приведена общая модель фотонного кристалла СВЧ-диапазона на основе волноводно-щелевых линий передачи.



Рисунок 2.1 – Модель фотонного кристалла на основе волноводно-щелевой линии передачи. 1 – ширина поликоровой подложки 10 мм; 2 – длина поликоровой подложки 13 мм; 3 – промежуток между пластинами 20 мм; 4 – ширина щели 4 мм; 5 – ширина алюминиевой пленки 3 мм

Исследование амплитудно-частотных характеристик СВЧ фотонного кристалла при изменении особенностей конструкции. Исследовалась зависимость коэффициентов отражения и прохождения для структуры, состоящей из 4 пластин длинной 13 мм, алюминиевым покрытием, толщиной 0.012 мм, ширина щели 4 мм, толщина подложки из поликора 1 мм, при изменении промежутка между пластинами от 19 мм до 21 мм с шагом 1 мм. (Рис. 2.2)



Рисунок 2.2 – Зависимости коэффициентов отражения и прохождения фотонного кристалла при различной величине промежутка между пластинами W, мм: 1 – 19; 2 – 20; 3 – 21;

Из результатов, представленных на рисунке 2.2, следует, что при увеличении длины промежутка между поликоровыми пластинами с алюминиевым покрытием АЧХ фотонного кристалла смещается в низкочастотную область, а также углубляется запрещенная зона.

Рассматривалась зависимость коэффициентов пропускания и отражения фотонного кристалла, состоящего из 4 при изменении длины пластин 12-14 мм с шагом 1 мм, алюминиевым покрытием, толщиной 0.012 мм, с промежутком 20 мм, толщина подложки из поликора 1 мм, при ширине щели от 4 мм. (Рис.2.3)

Из результатов, представленных на рисунке 2.3 следует, что при увеличение длины поликора АЧХ фотонного кристалла смещается в низкочастотную область, уменьшается глубина запрещенных зон.



Рисунок 2.3 – Зависимости коэффициентов отражения и прохождения фотонного кристалла при различной длине поликора, мм: 1 – 12; 2 – 13;3 – 14. Исследование амплитудно-частотных характеристик СВЧ фотонного кристалла в зависимости от параметров диэлектрической подложки. Исследовалась частотная зависимость коэффициентов отражения и прохождения для структуры, состоящей из 4 пластин длиной 13 мм, с промежутком 21 мм, покрытием из алюминия, толщиной 0.012 мм, ширина щели 4 мм, при

изменении толщины подложки из поликора с диэлектрической проницаемостью от 0.8 мм до 1.2 мм с шагом 0.1 мм. (Рис. 2.4)



Рисунок 2.4 – Частотные зависимости коэффициентов отражения и прохождения фотонного кристалла при различной толщине подложки *h*, мм: 1– 0.8; 2–0.9; 3 – 1.0; 4 – 1.1; 5 – 1.2

Из результатов, представленных на рисунке 2.4, следует, что увеличение толщины подложки приводит к смещению АЧХ в область низких частот и углублению запрещенной зоны.

Рассматривалась зависимость коэффициентов пропускания и отражения фотонного кристалла, состоящего из 4 пластин длинной 13 мм, алюминиевым покрытием, толщиной 0.012 мм, с промежутком 21 мм, толщина подложки из поликора 1 мм, при изменение ширине щели от 1 мм до 5 мм с шагом 1 мм. (Рис. 2.5)

Из результатов, представленных на рисунке 2.5 следует, что при уменьшении ширины щели АЧХ фотонного кристалла смещается в низкочастотную область, увеличивается глубина запрещенных зон, а также изменяется их количество.



Рисунок 2.5 – Зависимости коэффициентов отражения и прохождения фотонного кристалла при различной ширине щели d, мм: 1 – 4; 2 – 3; 3 – 2; 4 – 1.

Исследование амплитудно-частотных характеристик СВЧ фотонного кристалла с нарушением в виде изменённого расстояния между центральными отрезками щелевых линий, образующих фотонный кристалл. При внесении нарушения в виде изменения расстояния между центральными отрезками щелевых линий в структуру кристалла в запрещенной зоне появляется пик, называемый "окно прозрачности".

Исследовалась зависимость коэффициентов отражения и прохождения для структуры, состоящей из 4 пластин длиной 13 мм, алюминиевым покрытием, толщиной 0.012 мм, промежутком между пластинами 21 мм, ширина щели 4 мм, толщина подложки из поликора 1 мм, при изменении ширины нарушенного слоя в диапазоне от 25 мм до 29 мм с шагом 2мм. (Рис.2.6)



Рисунок 2.6 – Зависимости коэффициентов отражения и прохождения фотонного кристалла при различной величине нарушения t, мм: 1 – 29; 2 – 27; 3 – 25.

Из результатов, представленных на рисунке 2.6 можно видеть, что с увеличением ширины нарушенного слоя окно прозрачности смещается в низкочастотную область, а при уменьшении – в высокочастотную.

Экспериментальное исследование СВЧ фотонных кристаллов на основе волноводно-щелевых линий передачи. В ходе эксперимента была создана модель фотонный кристалл, состоящий из отрезков волноводнощелевых линий передачи, имеющих следующие параметры: толщина поликоровой подложки 1 мм, диэлектрическая проницаемость поликора 9.6, длина пластин поликора 23 мм, толщина алюминиевого слоя 0.012 мм, ширина щели 4 мм.

Частотные зависимости коэффициентов отражения и прохождения получены при помощи векторного анализатора цепей *N5230A Agilent PNA-L Network Analyzer* (рис.3.1).



Рисунок 3.1 – Векторный анализатор цепей *N5230A Agilent PNA-L Network Analyzer*Исследование амплитудно-частотных характеристик СВЧ фотонного кристалла в зависимости от расстояния между отрезками волноводнощелевых линий передачи Исследовалась зависимость АЧХ для различных расстояний W между отрезками щелевых линий передачи (рис.3.2; 3.3; 3.4; 3.5); 1–8 мм, 2–10мм, 3–12 мм и 4–20 мм)).



Рисунок 3.2 Теоретическая зависимость АЧХ СВЧ-фотонного кристалла от расстояния между отрезками полосковых линий передачи W, 8



Рисунок 3.3 Теоретическая зависимость АЧХ СВЧ-фотонного кристалла от расстояния между отрезками полосковых линий передачи W, 10 мм



Рисунок 3.4 Теоретическая зависимость АЧХ СВЧ-фотонного кристалла от расстояния между отрезками полосковых линий передачи W, 12 мм





Из результатов эксперимента, представленных на рисунках (3.2; 3.3; 3.4; 3.5) следует, что созданный фотонный кристалл на основе волноводно-

щелевых линий передачи образует разрешенные и запрещенные зоны в диапазоне частот 8–12 ГГц.

Подтверждены выявленные в теоретическом исследовании закономерности изменения АЧХ в зависимости от расстояния между отрезками, а именно: с увеличением длины промежутка между поликоровыми пластинами с алюминиевым покрытием АЧХ фотонного кристалла смещается в низкочастотную область, а также углубляется запрещенная зона.

Отличие количественных значений полученных АЧХ обусловлено неидеальностью созданной структуры, выражающейся в отличии параметров экспериментальной структуры от принятых в теоретической модели. Исследование амплитудно-частотных характеристик СВЧ фотонного кристалла с нарушением в виде изменённого расстояния между центральными отрезками щелевых линий, образующих фотонный кристалл. Исследовалась амплитудно-частотная характеристика фотонного кристалла для различных размеров нарушения, представляющего собой отрезок волновода между центральными отрезками щелевых линий передачи (рис.3.6; 3.7; 3.8) 1–5 мм, 2–17мм и 3–20 мм)).



Рисунок 3.6 Экспериментальная АЧХ СВЧ фотонного кристалла при размере нарушения t, 5 мм



Рисунок 3.7 Экспериментальная АЧХ СВЧ фотонного кристалла при размере нарушения t, 17 мм



Рисунок 3.8 Экспериментальная АЧХ СВЧ фотонного кристалла при размере нарушения t, 20 мм

Из результатов, представленных на рисунках 3.6; 3.7; 3.8, следует, что созданный фотонный кристалл на основе волноводно-щелевых линий передачи образует разрешенные и запрещенные зоны в диапазоне частот 8-12 ГГц. При создании нарушения в виде изменённого расстояния между

центральными отрезками щелевых линий, образующих фотонный кристалл, в запрещенной зоне образуется пик пропускания – «окно прозрачности».

Подтверждены выявленные В теоретическом исследовании закономерности изменения АЧХ в зависимости от длины нарушенного слоя, а именно: с увеличением ширины нарушенного слоя окно прозрачности область, смещается В низкочастотную a при уменьшении В высокочастотную.

Отличие количественных значений полученных АЧХ обусловлено неидеальностью созданной структуры, выражающейся в отличии параметров экспериментальной структуры от принятых в теоретической модели. Заключение. Был проведен анализ электродинамических характеристик соответствующих для щелевых линий передачи, применяемых в СВЧдиапазоне.

При помощи системы электродинамического моделирования и проектирования HFSS, была построена маодель фотонного кристалла в виде волноводно-щелевой линии.

Исследованы амплитудно-частотные характеристики структуры при различном расстоянии между отрезками волноводно-щелевых линий передачи, а также при различной длине нарушенного слоя между центральными отрезками волноводно-щелевых линий передачи.

Проведен анализ амплитудно-частотных характеристик фотонного кристалла в виде волноводно-щелевой линии передачи при различных параметрах диэлектрической подложки, а именно, разных длинах и различной ширине щели отрезков волноводно-щелевых линий передачи.

Был создан макет фотонного кристалла на основе волноводно-щелевой линии передачи.

Проведено экспериментальное исследование созданного фотонного кристалла в виде волноводно-щелевой линии передачи.

Установлено, что увеличение толщины подложки приводит к смещению АЧХ в область низких частот, глубина запрещенной зоны уменьшается, при промежутка между поликоровыми увеличении длины пластинами С АЧХ алюминиевым покрытием фотонного кристалла смещается В низкочастотную область, а также углубляется запрещенная зона, при уменьшении ширины щели АЧХ фотонного кристалла смещается В низкочастотную область, увеличивается глубина запрещенных зон, С увеличением ширины нарушенного слоя окно прозрачности смещается в низкочастотную область, а при уменьшении – в высокочастотную.